



## Révision de la loi sur la protection des dessins et modèles en Chine : Une instigation à l'accès à la protection.

Ces dernières années, le gouvernement Chinois s'est efforcé de convaincre les entreprises étrangères de la réelle amélioration de la protection des droits de la propriété industrielle en République Populaire de Chine.

Cette volonté affichée l'a conduit à se doter d'un arsenal législatif approprié, qui vient encore tout récemment de s'affermir eu égard à la protection des dessins et modèles industriels.

Pour rappel, la Chine a accédé à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle. Ainsi, dans les six mois suivant le dépôt d'une demande de dessin et modèle dans un pays membre de l'Union, le demandeur jouit d'une priorité pour son enregistrement en Chine lui permettant de bénéficier de la date du premier dépôt revendiqué.

La Chine a également adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

En intégrant l'OMC en 2001, la Chine a par ailleurs souscrit à l'Accord relatif aux droits de propriété intellectuelle qui l'encourage à une mise en conformité de ses lois avec les standards internationaux.

Les révisions successives de la Loi sur la protection des dessins et modèles, dont la 3ème a été adoptée le 27 décembre 2008, témoignent de la persévérance de la Chine en ce sens.

Entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2009, les dispositions de la nouvelle loi ont été précisées par voie réglementaire applicable depuis le 1er Février 2010.

Retour sur quelques unes des principales dispositions de la nouvelle Loi et ses conséquences pratiques sur l'accès à la protection:

### 1. L'introduction d'une procédure de dépôts multiples

Les nouveaux déposants sont enfin autorisés à procéder au dépôt multiple de plusieurs dessins et modèles.

Un même demandeur peut donc dorénavant solliciter l'enregistrement de plusieurs dessins et modèles dans le cadre d'un dépôt commun.

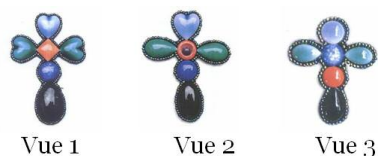
Cette possibilité doit toutefois s'inscrire dans les conditions suivantes :

- lorsque les dessins et modèles destinés à être incorporés dans un même produit, sont similaires.

- Ce même dépôt peut donc inclure des dessins et modèles déclinés dans des couleurs différentes :



Ou



Cette similarité s'apprécie eu égard à la description succincte du dessin et modèle, désormais imposée lors du dépôt.

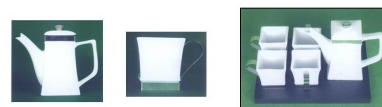
Jusqu'alors, l'enregistrement d'un modèle en Chine encourait le risque d'être invalidé du fait de l'existence d'un modèle similaire précédemment déposé par une même entreprise.

L'introduction du système de dépôt multiple constitue un palliatif à ce risque, sous réserve d'être bien utilisé.

- le regroupement de dessins et modèles dans une demande commune est également envisageable lorsqu'ils appartiennent à la même « famille d'objet ».

Il s'agit de dessins et modèles d'articles vendus ou utilisables simultanément, comme par exemple un couteau, une fourchette et une cuillère pouvant dès aujourd'hui être enregistrés dans un seul dépôt de dessin ou modèle pour une série d'objets.

Pour exemple :



Ou



Il est à noter que le nombre de dessins et modèles pouvant être regroupés dans un dépôt multiple en Chine est limité à 10 vues.

Le principal avantage est la réduction des coûts de protection de vos dessins et modèles en Chine.

On peut toutefois regretter que cette nouvelle loi ne soit pas allée plus loin en prévoyant une protection des dessins et modèles partiels.



## Exclusions de la protection à titre de dessin et modèle

En effet, la nouvelle Loi exclut formellement la protection des dessins et modèles suivants :

- dessins et modèles bidimensionnels : le dessin basé sur le motif, la couleur ou leur combinaison qui sert principalement de logo n'est pas protégeable.



Non protégeable

Dorénavant, la protection à titre de dessin et modèle devrait principalement être accordée aux objets en trois dimensions.

Cette disposition traduit une volonté de dresser une frontière bien distincte entre les protections accordées à titre de dessin et modèle et celles octroyées à titre de marque.

En tout état de cause, elle aura pour effet de dissuader le dépôt de dessins et modèles déjà enregistrés à titre de marque par des tiers profitant de l'absence d'examen substantiel des demandes de protection.

- Les dessins et modèles partiels, c'est-à-dire inséparables ou inutilisables indépendamment du produit auquel ils sont intégrés.



Protégeable



Non-protégeable

## 2. Modification des conditions de délivrance des dessins et modèles

Sous l'ancienne Loi, seul un dessin et modèle ayant fait l'objet d'une publication en Chine ou à l'étranger ou ayant fait l'objet d'une divulgation sur le territoire chinois

seulement, pouvait invalider l'enregistrement d'un dessin et modèle identique ou similaire en Chine.

Ainsi, l'utilisation d'un dessin et modèle non publié hors de Chine ou sa divulgation orale faite en dehors de la Chine ne constituaient pas un obstacle à la protection.

Or, dorénavant, tout dessin ou modèle « existant », c'est-à-dire connu ou utilisé par le public non seulement chinois mais désormais également étranger avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement empêchera l'octroi d'un enregistrement en Chine.

Le passage d'un critère de nouveauté relative à l'exigence de nouveauté absolue devrait ainsi renforcer le refus de délivrance de titre de propriété en Chine, basé sur des droits déjà existants à l'étranger.

Dans les faits, cette nouvelle exigence est associée à la création d'une base de données de formes tridimensionnelles dans laquelle l'Office pourra puiser pour soulever de façon plus efficace l'indisponibilité du dessin et modèle déposé.

Il est donc à craindre que le nombre de refus de délivrance augmente. Il convient dès lors de prendre en compte la nouveauté absolue comme l'élément majeur d'obtention de la protection.

Le pendant de ce durcissement en matière d'accès à la protection demeure toutefois favorable aux créateurs étrangers dans la mesure où toute divulgation de leur produit hors de Chine pourra être opposée à la validité d'un dessin et modèle identique ou similaire sur ce territoire.

En tout état de cause, les efforts fournis par la Chine en vue de créer un environnement toujours plus favorable à la protection de la propriété intellectuelle ne peuvent qu'être appréciés, même s'il reste encore à faire.

**Elodie DELLAVOLTA**

Juriste  
Marques, Dessins & Modèles

